

ICS 01.040.71,71.040.40  
G 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 22461—2008/ISO 18115:2001

GB/T 22461—2008/ISO 18115:2001

## 表面化学分析 词汇

Surface chemical analysis—Vocabulary

(ISO 18115:2001, IDT)

中华人民共和国  
国家标准  
表面化学分析 词汇

GB/T 22461—2008/ISO 18115:2001

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 3.75 字数 116 千字

2009年3月第一版 2009年3月第一次印刷

\*

书号:155066·1-35332 定价 38.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 22461-2008

2008-10-30 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 缩略语 .....	1
3 格式 .....	2
4 表面分析方法的定义 .....	2
5 表面分析词汇的定义 .....	3
附录 A(资料性附录) 术语补充说明 .....	42
参考文献 .....	44
中文索引 .....	45
英文索引 .....	50

secondary-ion yield .....	5.272	surface .....	5.303
segregation .....	5.273	surface contamination .....	5.304
selected area aperture .....	5.274	surface coverage .....	5.305
sensitivity factor, absolute elemental .....	5.275	surface segregation .....	5.306
sensitivity factor, relative elemental .....	5.276	synchrotron radiation .....	5.307
sensitivity factor, relative elemental .....	5.277		
sensitivity factor, relative isotopic .....	5.278	<b>T</b>	
Shakeoff .....	5.279	target .....	5.308
Shakeup .....	5.280	target thick .....	5.309
signal-to-noise ratio .....	5.281	target, thin .....	5.310
SIMS .....	4.9	thin film .....	5.311
smoothing .....	5.282	time constant .....	5.312
SNMS .....	4.10	topographic contrast .....	5.313
spectrometer dispersion .....	5.283	total reflection .....	5.314
analyser dispersion .....	5.283	transformation probability .....	5.315
spectrometer dispersion .....	5.284	transverse range .....	5.316
analyser dispersion .....	5.284	transverse straggling .....	5.317
spectrometer étendue .....	5.285	TXRF .....	4.12
spectrometer response function .....	5.286		
spectrometer transmission function .....	5.287	<b>U</b>	
analyser transmission function .....	5.287	UPS .....	4.13
spectrum, aligned incidence .....	5.288		
spectrum, random incidence .....	5.289	<b>V</b>	
spin orbit splitting .....	5.290	vacuum level .....	5.318
sputter depth profile ,SDP .....	5.291	vacuum level referencing .....	5.319
sputtering .....	5.292	vacuum level, standard .....	5.320
sputtering, equilibrium surface		valence band spectrum .....	5.321
composition .....	5.293		
sputtering, preferential .....	5.294	<b>W</b>	
sputtering rate .....	5.295	Work function .....	5.322
sputtering yield .....	5.296		
sputtering yield, fractional .....	5.297	<b>X</b>	
sputtering yield, partial .....	5.297	XPS .....	4.14
static SIMS .....	4.11	X-ray ghost line .....	5.323
stopping cross-sections, electronic .....	5.298	X-ray linewidth .....	5.324
stopping cross-section factor .....	5.299	X-ray monochromator .....	5.325
stopping cross-section, nuclear .....	5.300		
stopping power .....	5.301	<b>Z</b>	
super Coster-Kronig transition .....	5.302	zone of mixing .....	5.326

## 前 言

本标准等同采用 ISO 18115:2001《表面化学分析——词汇》。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由全国微束标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束标准化技术委员会(SAC/TC 38)归口。

本标准负责起草单位:北京大学、清华大学。

本标准主要起草人:黄惠忠、曹立礼。